

# Panier De Nettoyage Pour Photomasque 6 Pouces Personnalisé En Ptfé Résistant À La Corrosion Avec Double Poignée

Numéro d'article: PL-CP05



## Introduction

Les paniers de nettoyage pour photomasque 6 pouces personnalisés en PTFE haute performance offrent une résistance chimique inégalée pour les procédés humides en laboratoire et dans l'industrie des semi-conducteurs. Ces paniers durables assurent une manipulation sécurisée des échantillons, un drainage rapide et un nettoyage sans contamination dans des acides et solvants agressifs.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
<b>Nettoyage RCA pour semi-conducteurs</b>	Immersion séquentielle de wafers de silicium dans des solutions SC-1 et SC-2 pour éliminer les contaminants organiques et métalliques.	La résistance totale aux agents oxydants et aux acides à haute température garantit aucune dégradation du support.
<b>Gravure de photomasque</b>	Support de photomasques de 6 pouces pendant l'élimination de couches bloquant la lumière comme le chrome à l'aide d'agents de gravure agressifs.	Un positionnement sécurisé empêche la vibration du masque, garantissant un transfert de motif haute fidélité et aucune rayure de surface.
<b>Texturation de cellules solaires</b>	Procédé de création de micro-pyramides sur des surfaces de silicium à l'aide de mélanges KOH ou HF/HNO3 pour améliorer l'absorption de la lumière.	La conception robuste à double poignée permet une manipulation sécurisée dans des environnements industriels à haut volume et à cuves profondes.
<b>MEMS et microfluidique</b>	Nettoyage et gravure de substrats en verre ou en silicium utilisés dans la fabrication de systèmes microélectromécaniques.	La pureté du matériau empêche l'introduction d'impuretés traces qui pourraient interférer avec le fonctionnement des dispositifs à l'échelle microscopique.
<b>Verrerie pour analyse de traces</b>	Support de bécards, couvercles ou petits composants pendant le nettoyage à la vapeur d'acide spécialisé ou le trempage.	L'absence garantie d'ions métalliques (sans ions) en fait la référence pour le soutien à l'analyse d'éléments ultra-traces.
<b>Préparation de verre conducteur</b>	Nettoyage de substrats en verre revêtus ITO ou FTO pour la recherche sur les cellules solaires OLED ou à pérovskite.	La conception en grille permet un contact complet du fluide avec la couche conductrice tout en protégeant les bords du substrat.
<b>Développement chimique humide</b>	Transport de wafers revêtus de résine photosensible exposée à travers des solutions de développement dans les flux de lithographie.	La stabilité chimique sur différents développeurs organiques garantit des résultats cohérents et aucune interaction matérielle.

Paramètre	Détails de la spécification (Modèle : PL-CP05)
<b>Matériau principal</b>	Polytétrafluoroéthylène (PTFE) vierge haute pureté 100%
<b>Compatibilité de substrat</b>	Photomasques standard 6 pouces (152,4 mm), wafers ou verre
<b>Configuration de poignée</b>	Support renforcé à double poignée pour un levage vertical équilibré
<b>Résistance à la température</b>	-200°C à +260°C (-328°F à +500°F)
<b>Compatibilité chimique</b>	Universelle (Tous les acides, bases, solvants organiques et solutions de piranha)

Application	Description	Avantage clé
Paramètre	Détails de la spécification (Modèle : PL-CP05)	
<b>Configuration de fentes</b>	Largeur, pas et capacité totale des fentes personnalisables (standard 10/25 fentes)	
<b>Caractéristiques structurelles</b>	Base en grille usinée CNC pour drainage rapide ; points de contact d'échantillon arrondis	
<b>Finition de surface</b>	Surface en PTFE usinée lisse et non poreuse (Faible frottement)	
<b>Hauteur de poignée</b>	Personnalisable pour s'adapter aux profondeurs spécifiques des cuves de nettoyage	
<b>Teneur en métal</b>	Zéro (Construction sans métal)	